

## 金属顕微鏡システム（ニコン：LV-100D）

反射・透過照明両用型で、反射型の明視野/暗視野/微分干渉/蛍光/変更/二光束干渉観察に加え、透過型の微分干渉/暗視野/偏光/位相差観察が可能です。

1～20 $\mu$ m程度の試料をピックアップできるナノピンセットも装備されており、半導体デバイス、電子部品、素材・材料、精密金型など様々な用途に対応できます。



### 【仕様】

顕微鏡	工業顕微鏡UDM ECLIPSE LV100D-U
反射照明装置	LV-UEPI2
観察法（確認必要）	落射：明視野、暗視野、偏光、蛍光 透過：明視野、偏光、暗視野、位相差、微分干渉 オルソスコープ、コノスコープ
対物レンズ	LU Plan BD ELWD：5 $\times$ 、10 $\times$ 、20 $\times$ L Plan EPI SLWD：50 $\times$ LU Plan BD Fluor：50 $\times$ 、100 $\times$
デジタルカメラ	DS-Fi1
ソフトウェア	画像総合ソフトウェア NIS-Elements 画像タイリングシステム e-Tiling
付属システム	卓上型空気ばね式除振装置 AVT-0506NC トランスファーマン NK2 ナノピンセットシステム

設置場所 C10棟 302室

カテゴリー 観察